

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第1部門第1区分

【発行日】平成26年1月30日(2014.1.30)

【公表番号】特表2013-512694(P2013-512694A)

【公表日】平成25年4月18日(2013.4.18)

【年通号数】公開・登録公報2013-018

【出願番号】特願2012-543271(P2012-543271)

【国際特許分類】

C 12 N 1/00 (2006.01)

【F I】

C 12 N 1/00 B

【手続補正書】

【提出日】平成25年12月6日(2013.12.6)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

応答細胞集団を増殖させる方法であって、

気体透過性装置内において刺激細胞の存在下で応答細胞集団の増殖を開始する工程を含み、

前記装置は、培地と、気体透過材料を含む増殖表面に静置された前記応答細胞集団と前記刺激細胞とを含み、

前記応答細胞対前記刺激細胞の比は4:1未満である、方法。

【請求項2】

増殖表面積に対する前記培地の比が1m¹/cm²を超えており、請求項1に記載の方法。

【請求項3】

増殖表面積に対する前記培地の比が2m¹/cm²を超えており、請求項2に記載の方法。

【請求項4】

最低位置から最高位置まで測定された前記培地の高さは少なくとも1.0cmである、請求項1に記載の方法。

【請求項5】

最低位置から最高位置まで測定された前記培地の高さは2.0cm以上である、請求項4に記載の方法。

【請求項6】

前記培地中の応答細胞および刺激細胞の混合集団は、前記増殖表面の面積1cm²あたり500,000細胞未満の密度である、請求項4に記載の方法。

【請求項7】

前記培地中の応答細胞および刺激細胞の混合集団は、前記培地の1m¹あたり500,000細胞未満の密度である、請求項4に記載の方法。

【請求項8】

前記応答細胞対前記刺激細胞の比は少なくとも1:5である、請求項1に記載の方法。

【請求項9】

前記気体透過材料はシリコーンを含む、請求項1に記載の方法。

【請求項 10】

前記刺激細胞はフィーダ細胞である、請求項1に記載の方法。

【請求項 11】

前記フィーダ細胞は、照射されている、請求項10に記載の方法。

【請求項 12】

前記刺激細胞は、抗原提示細胞である、請求項1に記載の方法。

【請求項 13】

前記刺激細胞は、フィーダ細胞および抗原提示細胞を含む、請求項1に記載の方法。

【請求項 14】

前記応答細胞は、前記増殖表面の面積1cm²あたり7×10⁶細胞を超える細胞表面密度にまで増殖する、請求項1に記載の方法。

【請求項 15】

前記応答細胞は、抗原特異的T細胞である、請求項1に記載の方法。

【請求項 16】

前記応答細胞は、腫瘍浸潤リンパ球である、請求項1に記載の方法。

【請求項 17】

前記応答細胞は、ナチュラルキラー細胞である、請求項1に記載の方法。

【請求項 18】

前記応答細胞は、制御性T細胞である、請求項1に記載の方法。

【請求項 19】

前記応答細胞は、初代Tリンパ球である、請求項1に記載の方法。